

220829

ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงกระบวนการสร้างและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นพอร์สซิลิคอนในอุปกรณ์ตรวจจับไอลอคօหอล์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถสร้างได้ง่าย สร้างบนเนื้อซิลิคอนใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งมีโครงสร้างประกอบไปด้วยชั้นพอร์สซิลิคอนกับชั้วอุบมิเนย์ม 2 ชั้ว โดยทำการสร้างชั้นพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอกโนไดซ์ เชิงชั้นบนแผ่นซิลิคอนชนิดพี และทำการสร้างชั้วอุบมิเนย์มบนชั้นพอร์สซิลิคอนที่มีระยะห่างระหว่างชั้วไฟฟ้า $500 \mu\text{m}$ ซึ่งชั้นพอร์สซิลิคอนจะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับไอลอคօหอล์ ดังนั้นจึงได้ทำการทดลองศึกษาการสร้างชั้นพอร์สซิลิคอนด้วยวิธีการแอกโนไดซ์เชิงชั้น โดยคำนึงถึงผลของความเข้มข้นสารละลายน้ำไฮโดรฟลูออริก เวลา และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างชั้นพอร์สซิลิคอน แล้วทำการทดลองตรวจจับไอลอคօหอล์ พนว่าชั้นพอร์สซิลิคอนที่ใช้อัตราส่วนสารละลายน้ำไฮโดรฟลูออริกต่อเอทานอลเป็น 4:1 โดยปริมาตร เวลา 10 นาที และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 10 mA/cm^2 เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับไอลอคօหอล์

220829

The purpose of this research is to present the fabrication process and electrical characteristics of porous silicon sensor in alcohol vapor. The advantage of this device are simple process compatible in silicon technology and usable in room temperature. The device consists of porous silicon layer which is deposited by aluminum film with $500 \mu\text{m}$ electrode gap. Porous silicon is used as the alcohol vapor sensing element. In this study, the porous silicon was formed by anodization of silicon wafer in hydrofluoric solution and the effect of mixing ethanol in hydrofluoric solution, time and current were examined. The result showed that when using hydrofluoric solution and ethanol 4:1 by volume with current 10 mA/cm^2 in 2 minutes, the porous silicon can detect alcohol vapor efficiently.